

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号

特表2012-519406

(P2012-519406A)

(43) 公表日 平成24年8月23日(2012.8.23)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
HO4R 19/00 (2006.01)	HO4R 19/00 330	4C601
A61B 8/00 (2006.01)	A61B 8/00	5D019
HO4R 1/34 (2006.01)	HO4R 1/34 330A	
HO4R 1/44 (2006.01)	HO4R 1/44 330K	

審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 14 頁)

(21) 出願番号 特願2011-551551 (P2011-551551)
 (86) (22) 出願日 平成22年2月10日 (2010.2.10)
 (85) 翻訳文提出日 平成23年8月12日 (2011.8.12)
 (86) 国際出願番号 PCT/IB2010/050614
 (87) 国際公開番号 WO2010/097729
 (87) 国際公開日 平成22年9月2日 (2010.9.2)
 (31) 優先権主張番号 61/155,988
 (32) 優先日 平成21年2月27日 (2009.2.27)
 (33) 優先権主張国 米国 (US)

(71) 出願人 590000248
 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ
 オランダ国 5621 ペーアー アインドーフエン フルーネヴァウツウェッハ 1
 (74) 代理人 100087789
 弁理士 津軽 進
 (74) 代理人 100122769
 弁理士 笛田 秀仙
 (74) 代理人 100163809
 弁理士 五十嵐 貴裕

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 機械的な圧壊保持機能を備える事前圧壊CMUT

(57) 【要約】

超音波CMUTトランスデューサアレイでの使用に適したCMUTトランスデューサセルが、第1の電極を持つメンブレンと、第2の電極を持つ基板と、メンブレン及び基板の間の空腔とを持つ。このCMUTは、空腔の床との間で圧壊状態にあるようメンブレンをバイアスすることにより、事前圧壊状態にて作動され、レンズが、圧壊メンブレンに対して流し込まれる。レンズ物質が、重合するか、又は十分な剛性のとき、バイアス電圧は、除去され、レンズ物質は、メンブレンを圧壊状態に保持する。

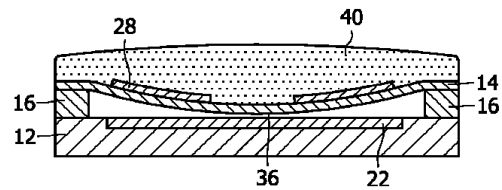


FIG. 7

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

C M U T トランスデューサセルであって、
基板と、
前記基板に付けられる第 1 の電極と、
前記第 1 の電極に対して離間関係において形成される可動メンブレンと、
前記メンブレンに付けられる第 2 の電極と、
バイアス電圧がない場合事前圧壊状態において前記メンブレンを保持するよう機能し、
前記メンブレンが事前圧壊状態にあるとき前記可動メンブレンをオーバーレイする保持部材とを有する、C M U T トランスデューサセル。

10

【請求項 2】

前記保持部材が、トランスデューサレンズである、請求項 1 に記載の C M U T トランスデューサセル。

【請求項 3】

前記トランスデューサレンズが、ポリジメチルシロキサン、P D M S、R T V ゴム、ウレタン、ビニルプラスチック又は熱可塑性エラストマの 1 つから作られる、請求項 2 に記載の C M U T トランスデューサセル。

【請求項 4】

前記メンブレンがバイアス電圧により事前圧壊状態にされる間、前記保持部材が前記 C M U T トランスデューサセルに対して流し込まれる、請求項 1 に記載の C M U T トランスデューサセル。

20

【請求項 5】

前記メンブレンが前記メンブレンに対する圧力の印加により事前圧壊状態にされる間、前記保持部材が前記 C M U T トランスデューサセルに対して流し込まれる、請求項 1 に記載の C M U T トランスデューサセル。

【請求項 6】

前記圧力が、大気圧である、請求項 5 に記載の C M U T トランスデューサセル。

【請求項 7】

請求項 1 の記載の C M U T トランスデューサセルを複数有する C M U T トランスデューサアレイであって、

30

前記保持部材が、前記 C M U T トランスデューサセルのアレイにわたり形成される音響レンズを更に有する、C M U T トランスデューサアレイ。

【請求項 8】

前記音響レンズが、平面波の関心フィールドより少ない関心フィールド内の固定焦点を持つ前記アレイを提供する、請求項 7 に記載の C M U T トランスデューサアレイ。

【請求項 9】

前記トランスデューサアレイが、C M O S 互換の半導体処理により形成され、
前記トランスデューサアレイは、診断超音波プローブに組み込まれ、
前記超音波プローブが、前記アレイを作動させるため前記トランスデューサアレイに結合される電子回路を更に有し、

40

前記電子回路は、C M O S 互換の半導体処理により形成される、請求項 7 に記載の C M U T トランスデューサアレイ。

【請求項 10】

前記電子回路が、マイクロビーム形成器回路を更に有する、請求項 9 に記載の C M U T トランスデューサアレイ。

【請求項 11】

前記トランスデューサアレイ及び前記マイクロビーム形成器回路が更に、同じ半導体基板上に作られる、請求項 10 に記載の C M U T トランスデューサアレイ。

【請求項 12】

前記トランスデューサアレイが、C M O S 互換の半導体処理により形成され、

50

前記トランスデューサアレイは、治療超音波プローブに組み込まれ、
前記超音波プローブが、前記アレイを作動させるため前記トランスデューサアレイに結合される電子回路を更に有し、
前記電子機器回路は、CMOS互換の半導体処理により形成される、請求項7に記載のCMUTトランスデューサアレイ。

【請求項13】

CMUTトランスデューサセルであって、
基板と、
前記基板に付けられる第1の電極と、
前記第1の電極に対して離間関係において形成される可動メンブレンと、
前記メンブレンに付けられる第2の電極と、
バイアス電圧がない場合事前圧壊状態において前記メンブレンを部分的に保持するよう機能し、前記メンブレンが部分的に事前圧壊状態にあるとき前記可動メンブレンをオーバーレイする保持部材とを有する、CMUTトランスデューサセル。

10

【請求項14】

前記第1及び第2の電極に印加されるバイアス電圧を更に有し、
前記保持部材及び前記バイアス電圧が、完全な事前圧壊状態において前記メンブレンを保持するよう機能する、請求項13に記載のCMUTトランスデューサセル。

【請求項15】

前記保持部材が、トランスデューサレンズである、請求項14に記載のCMUTトランスデューサセル。

20

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、医療診断超音波撮像に関し、特に、容量性マイクロマシン超音波トランスデューサ(CMUT)を用いる超音波プローブに関する。

【背景技術】

【0002】

医療撮像に使用される超音波トランスデューサは、高品質診断画像の生成をもたらす多数の特性を持つ。中でも、幅広い帯域幅と、超音波周波数での低レベル音響信号に対する高感度とが存在する。従来は、これらの特性を備え、従って超音波トランスデューサのために用いられる圧電材料は、PZT及びPVDf物質から作られ、PZTが最も好まれている。しかしながら、セラミックPZT物質は、ダイシングと、整合層結合と、フィラー(filler)と、電気メッキと、相互接続とを含む製造プロセスを必要とする。これらは、明確に異なり、複雑であり、かつ広範囲な処理を必要とする。こうした全ての状況が、望みより少ないトランスデューサスタックユニット収率を生じさせる可能性がある。更に、この製造の複雑さは、最終的なトランスデューサプローブのコストを上昇させる。超音波システムメインフレームが、より小さくされるようになり、信号処理機能の多くに関して、フィールドプログラム可能ゲートアレイ(FPGA)及びソフトウェアにより支配されるようになったことから、システムメインフレームのコストは、システムのサイズと共に小さくなった。今や超音波システムは、安価な携帯型、デスクトップ型及びハンドヘルド型において利用可能である。結果として、トランスデューサプローブのコストは、システム全体のコストに占める割合において絶えず増加している。この増加は、3Dイメージングに使用されるより要素数の多いアレイの出現により加速されている。従って、低コスト超音波システムに対する要求を容易にするため、改良された収率を持ち、より低コストでトランスデューサアレイを製造することが可能なことが望ましい。

30

40

【0003】

最近の開発は、医療超音波トランスデューサが半導体処理により製造されることができるとの見込みをもたらした。望ましくは、これらの処理は、例えばCMOS処理といった超音波プローブにより必要とされる電気回路を生み出すのに用いられる処理と同じであるべき

50

である。これらの開発は、マイクロマシン超音波トランスデューサ、即ちMUTを生み出した。MUTは、2つの設計手法において製造された。1つは、圧電特性を持つ半導体層を用いるもの(PMUT)、もう1つは、容量性効果を示す電極板を持つ隔膜及び基板を用いるもの(CMUT)である。CMUTトランスデューサは、受信される超音波信号の音振動を変調された静電容量へと変換する電極を持つ小さい隔膜のようなデバイスである。送信のため、電極に印加される容量電荷は、デバイスの隔膜を振動させ、これにより音波を送信するよう変調される。これらのデバイスが半導体処理により製造されるので、デバイスは一般に、10~200ミクロンの範囲の寸法を持つが、300~500ミクロンのデバイス直径まで変動することができる。斯かる多くの個別のCMUTは、一緒に接続されることができ、単一のトランスデューサ要素として同調して作動されることができ

10

。例えば、4~16のCMUTが、単一のトランスデューサ要素として同調して機能するよう一緒に結合されることができ

。典型的な2Dトランスデューサアレイは、現在2000~3000の圧電トランスデューサ要素を持つ。CMUTアレイとして製造されるとき、百万以上のCMUTセルが用いられることになる。驚くべきことに、初期の結果は、このサイズの半導体ファブ(fab)CMUTアレイに関する収率が、数千トランスデューサ要素のPZTアレイに関する収率より著しく改善されることを示した。

【0004】

CMUTは最初、現在では「非圧壊」モードとして知られるモードで作動するよう作られた。図1を参照すると、典型的な非圧壊CMUTトランスデューサセル10が断面で示される。CMUTトランスデューサセル10は、例えばシリコンといった基板12上で複数の類似する隣接セルと共に作られる。窒化ケイ素から作られることができる隔膜又はメンブレン14は、シリコン酸化物又は窒化ケイ素から作られることができる絶縁性支持体16により基板の上に支持される。メンブレンと基板との間の空腔18は、空気とすることができる、若しくはガスで充填されることができ、又は、完全に若しくは部分的に真空とすることができる。金のような導電性薄膜又は層20が、隔膜上に電極を形成し、類似するフィルム又は層22が、基板上に電極を形成する。誘電空腔18により分離されるこれらの2つの電極が、静電容量を形成する。音響信号がメンブレン14を振動させる

20

とき、静電容量における変動が検出されることができ、これにより音響波が対応する電気信号へと変換される。逆にいえば、電極20、22に印加されるAC信号が静電容量を変調することになる。これは、メンブレンを動かす、これにより、音響信号が送信される。

30

【0005】

典型的なCMUTのミクロンサイズの寸法が原因で、多数のCMUTセルが通常、単一のトランスデューサ要素を形成するため、より近傍において製造される。個別のセルは、丸い、矩形、六角形又は他の周縁形状を持つことができる。図3は、本発明の円形CMUTセルの光学干渉計により生み出される局所解剖画像である。図4は、円形CMUTセルのアレイの干渉画像である。CMUTセルは、異なる寸法を持つことができる。その結果、トランスデューサ要素が、異なるセルサイズの複合特性を持ち、これが、トランスデューサに幅広い帯域特性を与えることになる。一般に、斯かるセルサイズの差は、必要でない。なぜなら、ほとんどのCMUTは通常、印加される信号帯域幅の100%以上の帯域幅を持つからである。

40

【0006】

CMUTは、本質的に二次デバイスである。その結果、音響信号は通常、印加される信号の高調波である。即ち、音響信号は、印加される電気信号の周波数の2倍にあることになる。この二次挙動を防止するために、2つの電極にバイアス電圧が印加される。これは、結果として生じるクーロン力により隔膜が基板に引きつけられることをもたらず。これは、図2に概略的に示される。そこでは、DCバイアス電圧 V_B が、バイアス端末24に印加され、例えば誘導インピーダンスといったAC信号に対する高インピーダンスZをもたらず経路によりメンブレン電極20に結合される。AC信号は、信号端子26からメンブレン電極へ/から容量結合される。メンブレン14上の正電荷は、メンブレンが膨張することをもたらず。なぜなら、メンブレンは、基板12上の負電荷に引きつけられるから

50

である。このバイアス状態で継続的に作動されるとき、CMUTセルは二次挙動をわずかしめ示さない。

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

メンブレンが膨張されるとき、CMUTの感度が最も良いことが分かった。その結果、容量デバイスの2つの反対の電荷のプレートができるだけ一緒に近くにある。2つのプレートが近接していることは、CMUTによる音響及び電気信号エネルギー間のより大きな結合をもたらすことになる。こうして、メンブレン14及び基板12の間の誘電間隔32が、動作する信号条件下で維持されることができるといふくらい小さくなるまで、バイアス電圧 V_B を増加させることが望ましい。構築された実施形態において、この間隔は、1マイクロン以下のオーダーにあった。しかしながら、印加されるバイアス電圧があまりに大きい場合、メンブレンは基板と接触する可能性があり、デバイスをショートさせる可能性がある。なぜなら、デバイスの2つのプレートが、ファンデルワールス力によりくっつけられるからである。CMUTセルがオーバードライブされるとき、このくっつきが起こる可能性があり、同じバイアス電圧 V_B でも製造耐性変動によりデバイス毎に変わる可能性がある。電気隔離層（例えば、窒化ケイ素）においてデバイス電極を埋め込むことにより永久的なくっつきは減らされることができるといふが、最大限の感度の範囲において非圧壊CMUTを作動させようとするとき、圧壊及び非圧壊状態の間の動作の非線形性は固有の不利な点となる。

10

20

【0008】

メンブレンが非常に小さなサブマイクロンの誘電間隔をもたらすようバイアスされる場合でさえ、CMUTの感度は要求される感度未満となる可能性がある。これは、以下の事実によるものである。メンブレンの中心32における電荷は、対向する電荷に比較的近く、そして対向する電荷に対してかなり動くことになるが、メンブレンが支持部16により支持されるメンブレンの周辺34での電荷は、ほとんど動かず、このデバイスによる信号の変換にほとんど関与しない。この不均衡を除去する1つの手法は、支持部16へと延在しない小さなメンブレン電極20を用いることである。これは、メンブレン電極上の電荷をデバイスの中央へと制限する。この中央は、メンブレンの動きに強く関与し、従って、デバイスによる変換に強く関与する。メンブレン電極20にバイアス電圧 V_B を印加し、AC信号を電極へ/から結合するための1つ又は複数の電気導体がまだなくてはならない。これらの電気導体は、必然的に非常に薄く、望ましくない大きさのインピーダンスをAC信号に課す寸法を持つ。これにより、デバイスの感度が限定される。

30

【0009】

本発明の目的は、良い感度を持つが、メンブレンがくっつき問題を起こさないCMUTトランスデューサセルを提供することである。

【0010】

本発明の更なる目的は、低バイアス電圧を用いて、動作の効率的な範囲に維持されることができるといふCMUTトランスデューサセルを提供することである。

【0011】

本発明の更なる目的は、予想される製造耐性の存在下において、ロット毎に一貫して作動するCMUTトランスデューサセルを提供することである。

40

【0012】

本発明の更なる目的は、例えばCMOS処理といったアレイを作動させるのに使用される集積回路の処理と互換性を持つ半導体処理を用いて製作されることができるといふCMUTトランスデューサアレイを提供することである。

【課題を解決するための手段】

【0013】

本発明の原理によれば、「事前圧壊」モードにおいて作動する超音波トランスデューサCMUTセルアレイが提供される。事前圧壊モードにおいて、くっつき問題は回避される

50

。なぜなら、メンブレンが絶えずCMUTセルの空腔の床と接触状態にあるからである。非圧壊及び事前圧壊状態の間の切り替えがなく、事前圧壊モードにおいて絶えず作動する動作範囲を用いることで、ヒステリシスが回避される。事前圧壊モードにメンブレンを維持するのに従来必要とされるバイアス電圧は、メンブレンの圧壊状態を物理的に維持する機械的な構造により置換される。これは、CMUTが、低い動作及びバイアス電圧での好ましい動作範囲において作動することを可能にする。好ましい実施形態において、CMUTセルを圧壊状態に維持する機械的な構造は、超音波変換器アレイのレンズである。

【図面の簡単な説明】

【0014】

【図1】典型的なCMUTトランスデューサセルの断面図である。

10

【図2】典型的なCMUTセルの電気特性の概略図である。

【図3】本発明のCMUTセルの局所解剖干渉画像である。

【図4】円形CMUTセルのアレイの干渉画像である。

【図5】本発明の原理に基づき構築されるCMUTセルの断面図である。

【図6】圧壊状態にバイアスされるとき図5のCMUTセルを示す図である。

【図7】セルの上で製作されるレンズによりメンブレンが圧壊状態に保持されるとき図6のCMUTセルを示す図である。

【図8】アレイに関する焦点特性を提供するレンズにより事前圧壊状態に保持されるCMUTセルのアレイを示す図である。

【図9】事前圧壊及び非圧壊にされるCMUTセルの結合係数の変動を電圧と共に示す図である。

20

【図10】本発明の構築された実施形態の測定された結合係数の変動を電圧と共に示す図である。

【発明を実施するための形態】

【0015】

図5を参照すると、CMUT要素5の概略的な断面図が示される。CMUT要素5は、基板層12、電極22、メンブレン層14及びメンブレン電極リング28を含む。このリングの円形状が図3及び図4において見られる。この例において、電極22は、円形に構成され、基板層12に埋め込まれる。更に、メンブレン層14は、基板層12の上端面に対して固定され、メンブレン層14及び基板層12の間の球面又は円筒状の空腔18を定めるよう構成される/必要な大きさにされる。上述したように、セル及びその空腔18は、代替的なジオメトリを定めることができる。例えば、空腔18は、矩形及び/又は正方形断面、六角形断面、楕円断面又は不規則な断面を定めることができる。

30

【0016】

底部電極22は通常、追加的な層(図示省略)を持つその空腔に面した表面上で絶縁される。好ましい絶縁層は、基板電極の上及びメンブレン電極の下に形成される酸化物-窒化物-酸化物(ONO)誘電層である。ONO誘電層は有利には、デバイス不安定性及び音響出力圧力におけるドリフト及び削減をもたらす電極上の電荷蓄積を減らす。CMUT上でのONO誘電層の作製は、Klootwijkらによる2008年9月16日出願の「Capacitive micromachined ultrasound transducer」というタイトルの欧州特許出願番号08305553.3号において詳述される。ONO誘電層の使用は、予め圧壊されたCMUTを用いることが望ましい。このCMUTは、非圧壊デバイスより、電荷保持に対して影響されやすい。開示された要素は、例えば、Al、Ti、窒化物(例えば、窒化ケイ素)、酸化物(様々なグレード)、テトラ・エチル・オキシ・シラン(TEOS)、ポリシリコン等といったCMOS互換の物質から製造されることができる。CMOSファブにおいて、例えば、酸化及び窒化層は、化学蒸着及びスパッタリング処理により付けられる金属化(電極)層により形成されることができる。適切なCMOS処理は、LPCVD及びPECVDである。後者は、400未満の比較的低い動作温度を持つ。

40

【0017】

開示された空腔18を生み出す例示的な技術は、メンブレン層14の上端面を加える前

50

にメンブレン層 14 の最初の部分において空腔を規定することを含む。他の製造及び詳細は、米国特許第 6,328,697 号 (Fraser) において見つけ出されることができる。図 5 に示される例示的な実施形態において、円筒状の空腔 18 の直径は、円形に構成された電極板 22 の直径より大きい。電極リング 28 は、円形に構成された電極板 22 と同じ外径を持つことができる。但し、斯かる一致は常に必要とされるものではない。こうして、本発明の例示的な実施形態において、電極リング 28 は、下で電極板 22 と揃うよう、メンブレン層 14 の上端面に対して固定される。

【0018】

図 6 は、事前圧壊状態にバイアスされるとき図 5 の CMUT セルを示す。ここでは、メンブレン 14 は、空腔 18 の床と接触状態にある。これは、電極リング 28 に印加される電圧 V_B と基板電極 22 に印加される基準電位 (接地) とにより示されるように、2 つの電極に対して DC バイアス電圧を印加することにより実現される。電極リング 28 が、中央において穴のない連続的なディスクとして形成されることもできるが、図 6 は、これがなぜ必要でないかを示す。メンブレン 14 がこの図に示されるように事前圧壊状態にバイアスされるとき、メンブレンの中央は、空腔 18 の床と接触状態にある。このように、メンブレン 14 の中央は、CMUT の動作の間、移動しない。むしろ、移動するのは、メンブレン 14 の周縁領域である。これは、空腔 18 の残りの開かれた空洞の上で、リング電極の下にある。リングとしてメンブレン電極 28 を形成することにより、デバイスの静電容量の上位プレートの電荷は、CMUT がトランスデューサとして動作するとき、移動及び容量性変動を示す CMUT の領域の上に配置される。こうして、CMUT トランスデューサの結合係数は改善される。

10

20

【0019】

必要なバイアス電圧を印加することにより符号 36 で示されるように、メンブレン 14 は、空腔 18 の床と接触状態にある事前圧壊状態にされることができる。このバイアス電圧は通常、50 ~ 100 ボルトの範囲である。電圧が増加するにつれ、CMUT セルの静電容量は、静電容量計で監視される。静電容量における急激な変化は、メンブレンが空腔の床に対して圧壊されたことを示す。ちょうど符号 36 で示されるように空腔の床に触れるまで、メンブレンは下方にバイアスされることができるか、又は最小の接点を越えて増加された圧壊となるまで更に下方にバイアスされることができる。

【0020】

メンブレン 14 を事前圧壊状態へとする別の態様は、メンブレンの上端に圧力を印加することである。空腔が部分的な又は完全な真空において形成されるとき、空腔 18 の床と接触するようメンブレン 14 を事前に圧壊するのに、1 パールの大気圧の印加が充分であることが分かっている。メンブレン 14 を制御可能に事前圧壊するため、圧力差とバイアス電圧とを組み合わせることも可能である。これは、高い大気崩壊圧 (例えば 10 パール) を持つことができるより小さなデバイスで効果的である。

30

【0021】

本発明の原理によれば、メンブレン 14 が、図 6 に示されるようにその事前圧壊状態にバイアスされつつ、その事前圧壊状態に物理的にメンブレンを保持する構造がメンブレンの上に配置又は形成される。超音波トランスデューサに関して好ましい実施形態において、この構造は、トランスデューサのレンズ 40 を形成する。トランスデューサレンズは通常、3 つの要件を満たす。1 つは、レンズがトランスデューサプローブの使用の間に生成される摩擦接触が原因による摩擦抵抗に耐える構造を提供するということである。実際、レンズは、下にあるトランスデューサレイを物理的な摩擦から保護する物理的なカバーを提供する。第 2 には、レンズは、非導電性であり、これによりトランスデューサの電気要素と患者との間の電気絶縁を提供する。第 3 には、レンズは、プローブに関する焦点特性を提供することができる。図 7 の例において、レンズ 40 は、第 4 の利点を提供する。それは、事前圧壊状態にメンブレン 14 を物理的に保持することである。

40

【0022】

様々な物質が、レンズ物質に関して用いられることができる。CMUT に関する唯一の

50

要件は、バイアス電圧が除去されたあと、メンブレンをその圧壊状態に保持するのに十分な剛性を持つ物質であるということである。1つの適切な物質は、ポリジメチルシロキサン(PDMS又はRTVゴム)である。バイアス電圧 V_B がその所望の圧壊状態にメンブレンを保持する間、RTV物質はCMUTに対して流し込まれる。RTVが重合し、その事前圧壊状態にメンブレンを物理的に保持するよう十分に硬化した後、バイアス電圧は除去されることができ、デバイスが動作のためバイアスされるまで再印加される必要はない。好ましくは、レンズ物質は、CMUTアレイの各メンブレンの周りの領域に結合される。レンズ40に適した他の物質は、ウレタンゴム、ビニルプラスチックゾル及び熱可塑性エラストマを含む。

【0023】

その事前圧壊状態においてメンブレンを物理的に保持することにより、動作バイアスがデバイスの使用の間印加されるまで、事前圧壊状態を維持するためのバイアスが必要とされることはない。これは、CMUTがより低い電圧で作動されることができるとを意味する。これは、小さな、携帯型超音波システムに関して有利である。更に、例えばロット毎のメンブレンサイズ、剛性又は空腔深さにおける変動といった製造及び物質特性における変動が原因による悪影響は、排除されることができ。これらの変動は、多かれ少なかれ、その事前圧壊状態へとCMUTを持ってくるのにバイアス電圧が必要とされることを意味することができる。バイアス電圧は、所望の圧壊度に従って調整される。レンズ物質は、この状態でメンブレンを保持する。従って、各CMUTアレイは、これらの耐性変動の存在下でさえ、カスタマイズされる同じ実行特性又はその結合に関してセットアップされることができ。例えば動作する電圧範囲、音響インピーダンス、静電容量及び結合係数といった特性に関するプローブのより大きな一様性が、実現されることができ。

【0024】

図8は、事前圧壊CMUT5のアレイがレンズ42により事前圧壊状態に保持される本発明の実現の例を示す。このレンズ物質は、人間の体よりゆっくりした音速を示す。これにより、中央焦点領域に向かってアレイが焦束される。集束レンズなしに、個別のCMUTが全て、まっすぐ前方に焦束され、アレイは全体として無限点に焦束される。斯かるアレイが所望の焦点範囲に焦束させるよう作動されるとき、所望の焦束を実現するには、相当な範囲の遅延が必要とされる。図8に示される集束レンズ42は、例えば図8のCMUTアレイの前に示される焦点範囲FRといった所望の焦点範囲内の公称焦点をアレイに与えるよう機能することができる。この初期焦点を提供するレンズを用いて、焦点範囲に含まれる特有の点又は領域へと焦点を変化させるのに必要とされる遅延の範囲は減らされる。関心焦点範囲内にレンズ焦点を配置することにより、ビーム形成器の遅延要件は、焦点が合っていない平面波アレイに必要とされる要件と比較して2倍分減らされることができ。アレイを作動させるビーム形成器の遅延要件が減らされるとき、ビーム形成器は一般に、より安価となり、設計及び製造がより容易となる。

【0025】

CMUTトランスデューサセルの例示的な構築されたアレイにおいて、各CMUTのメンブレンの直径又は幅は

$$50 \times m$$

であり、空腔深さは

$$0.33 \times m$$

であり、CMUT厚は

$$1-5 \times m$$

である。このレンズは、厚が

$$500-1000 \times m$$

10

20

30

40

50

であり、1メガパスカルの剛性を示す。

【0026】

事前圧壊状態におけるCMUTの結合係数は、改善され、非圧壊状態（図1及び図2）において作動するときのCMUTの場合より低電圧で変化されることができる。CMUTセルの結合係数は、デバイスによるエネルギー蓄積の効率の尺度であり、

$$k^2 = 1 - \frac{C_s}{C_T}$$

として計算される。ここで、

$$C_s = \frac{Q}{V}$$

10

及び

$$C_T = \frac{dQ}{dV}$$

が成り立ち、Qは、電荷であり、Vは、電圧である。従って、より高い結合係数は、超音波トランスデューサの望ましい属性である。このトランスデューサは、標準的な圧電トランスデューサ又はCMUTアレイトランスデューサである。CMUTセルの場合、図9において曲線52で示されよう、電圧がゼロから増加するとき、結合係数 k^2 の変動は、電圧と共に非圧壊状態において上昇する。メンブレンが図2における符号32で示されよう、CMUTセルの床により近くに接近するようバイアスされるとき、結合係数 k^2 はより急速に変化する。従って、非圧壊モードCMUTは、図9に示されるようにこのより高い電圧範囲56で作動される。しかしながら、事前圧壊状態において、電圧に伴う k^2 の変動は、曲線54で示されるものとなる。ここで、 k^2 の変動は、低電圧範囲ブラケット58により示される範囲において、より低電圧において最も急峻である。

20

【0027】

CMUT電極に対する印加電圧が、動作の圧壊領域へと非圧壊領域にわたり増加され、その後再度戻されるとき、結合係数変動は、ヒステリシス効果を呈する。基本的に、電圧が増加するにつれて、 k^2 は曲線52に沿って増加し、電圧が圧壊後減少されるとき、結合係数は曲線54に沿って減少する。このヒステリシスは、なぜ1つのモード又は他のモードで完全に作動することが望ましいかを示す。事前圧壊CMUTが、事前圧壊状態において完全に作動されるとき、図10における曲線60により示されるように、それはヒステリシス問題を持たない。曲線10は、電圧が変化されるとき、構築されたCMUTセルの結合係数の変化の実際の測定経路に沿って描画される。測定値は、曲線60に沿って小さな円により示される。本発明のCMUTセル又はアレイが、事前圧壊状態において継続的に作動されるとき、これはヒステリシス問題が起きないことを示す。

30

【0028】

前述したように、結合係数はすべての種類の超音波トランスデューサに対して測定されることができ、結合係数が大きくなればなるほど、トランスデューサプロブの性能はより良くなる。典型的なPZTトランスデューサプロブは、0.42の有効な結合係数 k_{eff}^2 （注目する共鳴モードだけを考慮したものである）を呈する。米国特許第6,465,937号（Chenその他）に記載されるように、より高い性能の物質の単一の圧電結晶は、約0.65の有効な結合係数を呈する。本発明の事前圧壊CMUTセルは、最良の単一の結晶アレイプロブの係数と同じ範囲における結合係数で生成されることができ、計算によれば、更により高い結合係数さえ可能でありえることが示される。

40

【0029】

当業者であれば、他の変形例を容易に思いつくであろう。例えば、レンズ物質は、完全な事前圧壊状態にメンブレンを保持する必要はない。レンズは、CMUTの床の方へ部分的にのみ圧壊された状態にメンブレンを保持するよう機能し、完全な圧壊状態へとメンブ

50

レンを持ってくるために、小さなバイアス電圧が使用される。言い換えると、完全な圧壊状態は、例えばレンズ物質といった保持部材により部分的に実現され、バイアス電圧により部分的に実現されることができる。本書で使用される「圧壊」又は「事前圧壊」という用語は、メンブレンが、CMUT空腔の床と接触状態にある、又は床に向かって部分的にのみ膨張されることを意味することができる。

【0030】

本発明のCMUTトランスデューサレイは、診断及び治療超音波プローブ両方での使用に適している。直径数センチメートルのCMUTアレイが、高強度焦点超音波(HIFU)プローブにおける用途を見出すことができる。本発明のCMUTトランスデューサは、外部(経胸腔的)、及び超音波プローブ内部(カテーテル)の両方で用いられることができる。前述したように、本発明のCMUTアレイは、プローブを作動させるのに必要なマイクロエレクトロニクスを用いた並列的作製に特に望ましい。例えば、CMUTアレイ及びそのマイクロビーム形成器を同じ又は結合された基板上に生成するのに使用されるCMOS処理に望ましい。

10

【図1】

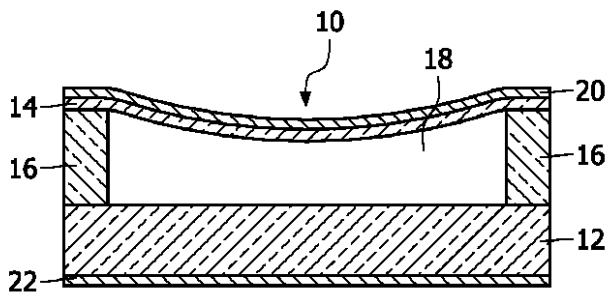


FIG. 1

【図3】

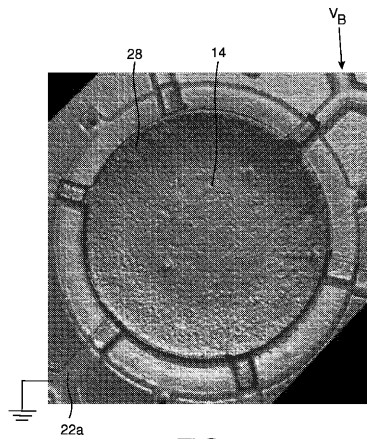


FIG. 3

【図2】

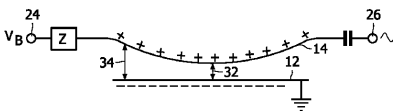


FIG. 2

【 図 4 】

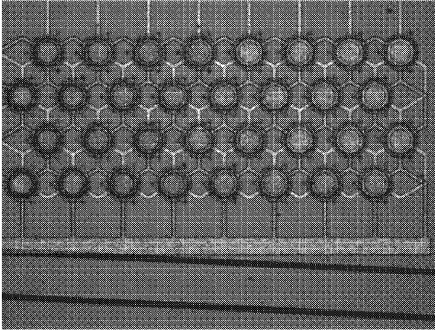


FIG. 4

【 図 5 】

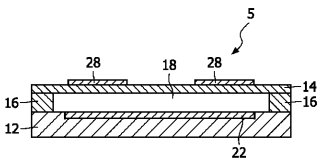


FIG. 5

【 図 6 】

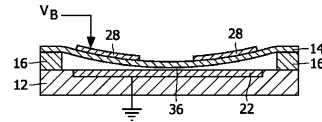


FIG. 6

【 図 7 】

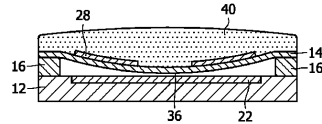


FIG. 7

【 図 8 】

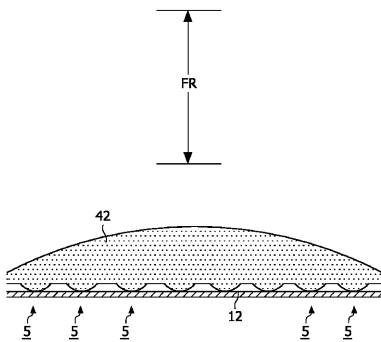
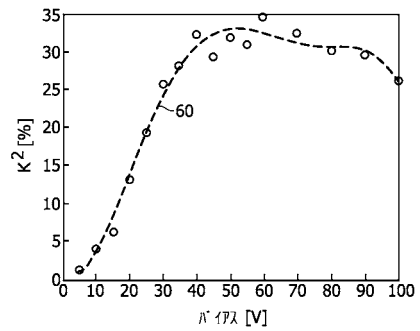


FIG. 8

【 図 10 】



【 図 9 】

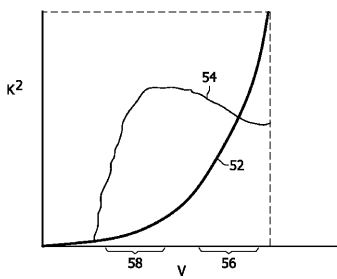


FIG. 9

【 国際調査報告 】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/IB2010/050614

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER INV. A61B8/00 B06B1/02 ADD.		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) A61B B06B H01G B81B G01S Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 2005/200241 A1 (DEGERTEKIN F L [US]) 15 September 2005 (2005-09-15) paragraph [0075] - paragraph [0089] figure 5	1-15
X,P	WO 2009/037655 A2 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL]; PHILIPS CORP [US]; DIRKSEN PETER) 26 March 2009 (2009-03-26) abstract	1,4,7,8, 10,13,14
L	page 10, line 20 - line 23 page 11, line 24 - line 32 page 12, line 1 - line 5 figures 5,9 claims 1,5	1,4,7,8, 10,13,14
<input type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C.		<input checked="" type="checkbox"/> See patent family annex.
* Special categories of cited documents :		
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance		"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"E" earlier document but published on or after the international filing date		"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)		"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means		"&" document member of the same patent family
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		
Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report	
23 April 2010	04/05/2010	
Name and mailing address of the ISA/ European Patent Office, P.B. 5818 Patentlean 2 NL - 2260 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Marteau, Frédéric	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/IB2010/050614

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 2005200241 A1	15-09-2005	EP 1769573 A2	04-04-2007
		JP 2007527285 T	27-09-2007
		WO 2005084284 A2	15-09-2005
<hr/>			
WO 2009037655 A2	26-03-2009	NONE	
<hr/>			

フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EP(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW

(72)発明者 ディルクセン ペテル

アメリカ合衆国 ニューヨーク州 10510-8001 プリアクリフ マノアー ピーオー
ボックス 3001 345 スカボロー ロード

Fターム(参考) 4C601 EE03 GB03 GB19 GB20 GB33 GB41 GB48
5D019 AA18 AA21 DD01 FF04 GG03 HH01

专利名称(译)	具有机械折叠保持功能的预压CMUT		
公开(公告)号	JP2012519406A	公开(公告)日	2012-08-23
申请号	JP2011551551	申请日	2010-02-10
[标]申请(专利权)人(译)	皇家飞利浦电子股份有限公司		
申请(专利权)人(译)	皇家飞利浦电子股份有限公司的Vie		
[标]发明人	デイルクセンペテル		
发明人	デイルクセン ペテル		
IPC分类号	H04R19/00 A61B8/00 H04R1/34 H04R1/44		
CPC分类号	A61B8/00 A61B8/4483 B06B1/0292		
FI分类号	H04R19/00.330 A61B8/00 H04R1/34.330.A H04R1/44.330.K		
F-TERM分类号	4C601/EE03 4C601/GB03 4C601/GB19 4C601/GB20 4C601/GB33 4C601/GB41 4C601/GB48 5D019/AA18 5D019/AA21 5D019/DD01 5D019/FF04 5D019/GG03 5D019/HH01		
优先权	61/155988 2009-02-27 US		
其他公开文献	JP5559818B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

适用于超声CMUT换能器阵列的CMUT换能器单元具有带第一电极的膜，带有第二电极的基板，以及膜和基板之间的空腔。CMUT通过将膜偏置到具有腔体底部的折叠状态而在预先折叠状态下操作，并且将透镜浇铸在折叠膜上。当镜片材料聚合或具有足够的刚度时，偏移电压被移除并且镜片材料将膜保持在收缩状态。

